

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl.⁷
H05B 33/10

(11)
(43)

10-2004-0098603
2004 11 20

(21) 10-2004-0034369
(22) 2004 05 14

(30) JP-P-2003-00137734 2003 05 15 (JP)

(71) 가 가 2 5 5

(72) 2-76-2

(74)

:

(54)

2 TFT(40)가 , EL , 2 (60)

2

1

2

3

< >

- 30 :
- 40 : 2 TFT
- 50 :
- 60 : 2

(TFT)

(LCD) EL EL

EL EL , LCD 가 , LCD 가

, LCD 2 TFT , 1 (TFT) EL 3 , (TFT) EL

가 1 TFT(10) n 1 TFT(10)

40) CS 가 , p SL CS가 DL 1 TFT(10) 2 TFT(

CV VL , EL EL

CS GL H 1 TFT(10)가 DL 가

, 2 TFT(40) CS EL EL 가 () 2 TFT(40) 가

, 1 TFT(10)가 DL , 가

, EL EL 가 , CS가 2 TFT(40) EL

2 EL , 가 TFT1 TFT2 가 . TFT1, TFT DL

, , 가 , , TFT1, TFT2

EL

가

, TFT2

, LCD

가 , YAG

(減点化)

, YAG

TFT가

, YAG
EL
EL

가

가

, LCD

가

1

1

가

가

가

1

EL

1, (30) TFT, (40)

c) (40a), (40c), (40a), (40d), (40e), (34), TFT, (36), (36), (40d), (36) ITO, (50)

EL EL (50) 가 가 GL, DL
 VL CS 2 TFT(40) Cdtr 2 TFT(40)
 2 TFT(40), 1 TFT(10) 2 TFT(40)
 1 TFT, CS, 2 TFT(40)

(50)(가) TFT, 2 TFT(40) VL

2 (a) TFT가 1 (36) (50)(
) (30)

VL 2 (b) (40)

2 (60) 2 (c)

2 (60) (50) (52), (54), (5
 6), (58) EL, 1 (54) 가 (50)
 (56) (54) 가 (56) Alq3

YAG, YAG 1064nm 533nm 가
 , TFT

(50) EL (50) 2 (60)

(60)

/ 가 1

EL EL (52), (54), (56)
 , 200nm
 2

TFT EL

, LCD , TFT ()
 , EL LCD
 , LCD TFT , , , 1
 TFT , , , ,
 , FIB(Focused Ion Beam)
 (60)) (50) (2
 , 가 , 2 (60)
 , 2 (60) , 2 (: 50) (60) , 가
 , 가 가 , 가

(57)

1.

2.

가 ,

, ,

,

2 3. ,

, 1 .

2 4. 3 ,

, ,

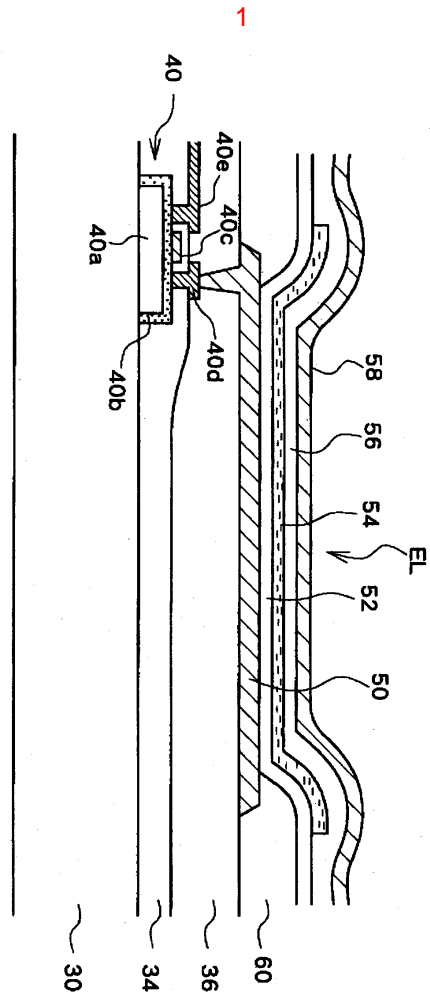
1 5. 3 ,

, .

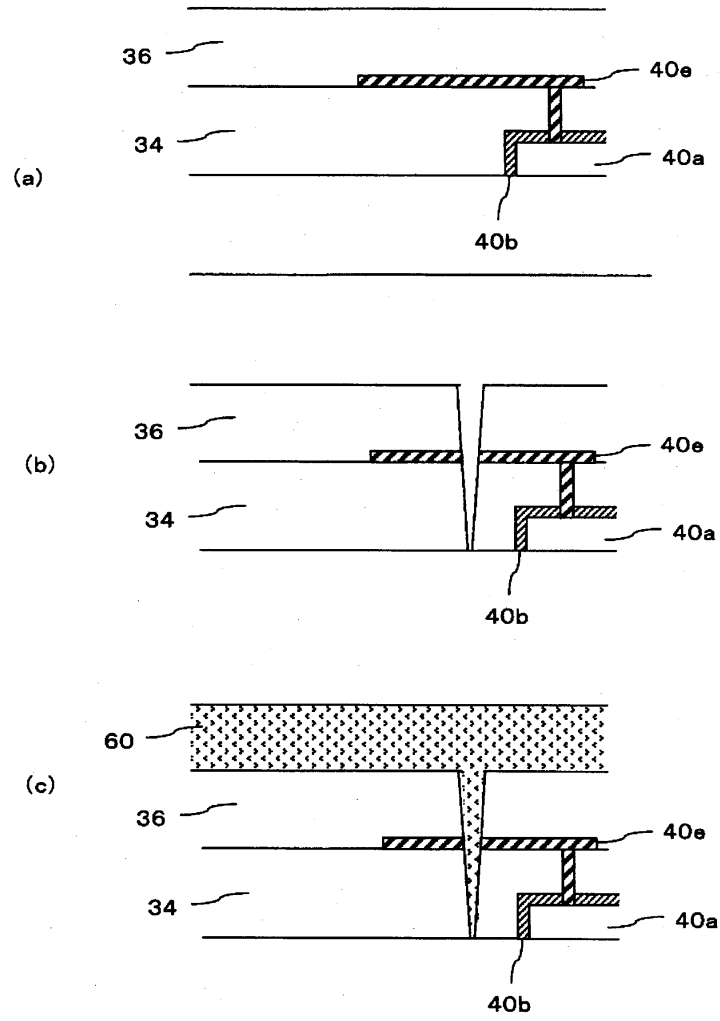
1 6. 3 ,

, EL .

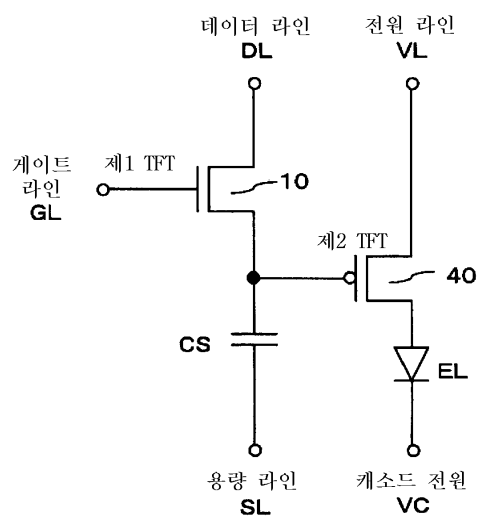
1 7. 3 .



2



3



专利名称(译)	显示面板和显示面板的制造方法		
公开(公告)号	KR1020040098603A	公开(公告)日	2004-11-20
申请号	KR1020040034369	申请日	2004-05-14
[标]申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社 山洋电气株式会社		
申请(专利权)人(译)	三洋电机有限公司是分租		
当前申请(专利权)人(译)	三洋电机有限公司是分租		
[标]发明人	JINNO YUSHI		
发明人	JINNO, YUSHI		
IPC分类号	H01L51/50 H01L27/32 G02F1/1362 H01L27/12 G09F9/30 H05B33/10 G09F9/00 H01L21/77 H05B33/22		
CPC分类号	H01L2251/568 H01L27/1214 H01L27/3244 G02F2001/136268 H01L27/124 H01L27/1248		
代理人(译)	LEE, JUNG HEE CHANG, SOO KIL		
优先权	2003137734 2003-05-15 JP		
其他公开文献	KR100630982B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

从而有效地使用激光劣化缺陷像素，同时抑制像素的劣化。在面板形成期间，例如，完成第二TFT 40，并且在形成有机EL元件的阳极的阶段检查阵列。对于缺陷像素，通过激光切割布线。然后，在使用激光修复之后，形成第二平坦化绝缘膜60以填充由激光形成的孔。2 指数方面 敏化，平面化绝缘膜，激光，阵列检测

